

ВІЛІВ РІВНЯ ЛЕГУВАННЯ КРЕМНІСВІХ Р-Н ПЕРЕХОДІВ НА ІХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК СЕНСОРІВ ПАРІВ АМІАКУ

Пташенко О.О.¹, Пташенко Ф.О.², Гільмутдінова В.Р.¹, Кирничук О.С.¹

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна

²Національний університет "Одеська морська академія", Одеса, Україна

Досліджено вплив рівня легування на поверхневий струм кремнісвіх р-н переходів, обумовлений адсорбцією парів води та аміаку. Вимірювання проведено на плазмних р-н переходах з градієнтом концентрації домішок від $a_N=1 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-4}$ до $a_N=5 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-4}$. Проведено чисельні двовимірні розрахунки нерівноважних поверхневих процесів у р-н переходах при адсорбції молекул донорного газу.

Встановлено наявність двох конкурючих механізмів газової чутливості р-н переходів. Перший з них пов'язаний з впливом електричного поля адсорбованіх іонів на струм, обумовлений рекомбінацією електронів і дірок через швидкі поверхневі глибокі центри. Другий механізм – це утворення поверхневого каналу з електронною провідністю, який "закорочує" р-н перехід.

ВАХ рекомбінаційного поверхневого струму відповідали виразу

$$I_R(V) = I_0 \exp[qV/(n_e kT)], \quad (1)$$

де I_0 – стала; q – заряд електрона; k – стала Болтьмана; T – температура; $n_e = 2$ коефіцієнт неідеальності ВАХ. Рекомбінаційний струм був основним при достатньо низьких значеннях парціального тиску аміаку.

Чутливість р-н переходів як сенсорів парів аміаку визначалась за формулою

$$S = \Delta I / \Delta P, \quad (2)$$

де ΔI – зміна струму при зростанні парціального тиску парів NH_3 на ΔP при фіксованому значенні напруги. Адсорбція парів аміаку зменшувала рекомбінаційний струм в дослідженіх р-н переходах, що відповідало від'ємній чутливості, тобто $S_R < 0$. Розрахунки показали, що максимальний темп поверхневої рекомбінації спостерігається у точці, що відповідає максимуму добутку $f_s(1 - f_s)$, де $f_s = f_s(x)$ – коефіцієнт заповнення електронами даних центрів. При адсорбції донорних молекул величина f_s зростає, що веде до зменшення темпу поверхневої рекомбінації, тобто до від'ємної чутливості.

Поверхневий канал з електронною провідністю формувався у р-н переходах при достатньо високих значеннях парціального тиску P парів аміаку. ВАХ додаткового поверхневого струму в каналі, обумовленого адсорбцією парів аміаку, мала протяжну лінійну ділянку. Концентрація електронів у каналі зростала при підвищенні P , що відповідало додатній чутливості, тобто $S_{ch} > 0$.

Порогу чутливості р-н переходів як газових сенсорів відповідає таке мінімальне значення P_m парціального тиску парів аміаку, при якому $S = S_{ch} > 0$. Зі зниженням градієнта концентрації домішок у дослідженіх р-н переходах від $5 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-4}$ до $2 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-4}$ зменшується поріг чутливості P_m і зростає газова чутливість S , що пояснюється на основі проведених розрахунків. Подальше зниження градієнта концентрації домішок не приводило до зменшення порогу чутливості, що можна пояснити впливом додаткових факторів, наприклад, дефектності поверхні.

Отримані результати дозволяють оптимізувати структуру р-н переходів як газових сенсорів.